

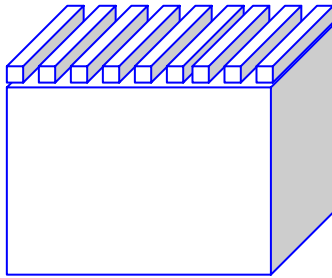


AccuSolve

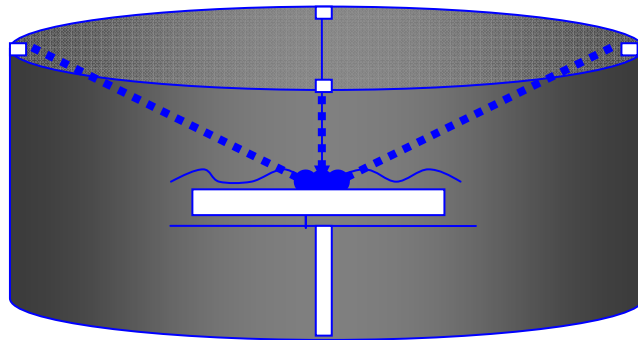
高性能フォトマスクプロセス向け EC フォトレジスト剥離装置 - アクキュ・ソルブ

AccuSolve は新処理液を利用し、フォトマスク材へダメージを与えないレジスト剥離プロセスを実現します。

UV Module



Solvent Processing Module



概要
Overview

プロセス
Process

システム
SYSTEM

その他
Other

ポストエッチフォトマスクの剥離プロセスとして、揮発性がほとんどない安全な処理液であるエチレンカーボネート(以降 EC と略す)を利用して、効果的にフォトレジストを除去することができます。

システムの特長

「安全な」水溶性有機溶剤系処理液	<ul style="list-style-type: none"> • フォトマスク材に影響を与えません • 硫化物を含みません • 沸点が高いため消防法の危険物ではないので、使用量・使用場所の制限を受けません • リサイクル効率が高いため低コストです
生分解性	<ul style="list-style-type: none"> • 廃液処理が不要です
UV モジュールとの組み合わせ	<ul style="list-style-type: none"> • ポストエッチフォトマスクの剥離プロセスにも対応します
温度コントロール	<ul style="list-style-type: none"> • レジストの状態に合わせてプロセスを最適化することができます